

RAITH VOYAGER 電子束微影系統 管理規則

113.07.10 修訂

1. 此機台開放等級為 B1 級，使用者經訓練且通過考核後可自行操作。此機台只提供破片自行操作,無委託代工服務！
2. 機台保養與考核時段不開放預約. 每時段為 1.5 小時，使用者一星期最多可預約 3 小時，每個實驗室,一星期最多預約 6 小時.
3. 星期一 13:00~16:00、星期三 9:00~12:00 為考核時間
4. 星期一/四 16:00 ~ 18:00 可洽工讀生上機訓練
5. 預約時段 15 分鐘未到者,視為放棄其他使用者可接著使用,不得異議.違規 2 次,停權 2 星期.
6. 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表，如有缺漏不實者，將視情節依 TSRI 規定議處。
7. 防止系統中毒,禁止使用個人 USB.使用者至少於曝光 3 個工作天前,將 .gds 格式的檔案寄給工程師.
8. 圖檔中的曝光圖層不可存於 61 或 62 與 63 層！
9. 每次曝光單一檔案大小不可超過 200 M,加總大小不超過 700 M.
10. 每次曝光時間不可超過 2.5 小時！
11. 阻劑塗佈後需經軟烤,未做軟烤不可進入系統的真空腔體！
12. 曝光後線寬的量測，由使用者自行量測。
13. 為活化硬碟空間，機台每年 5 月進行曝光檔案清理，使用者請於 4 月底前將欲保留的檔案名稱列表繳交機台負責人,若因未繳交或是表列遺漏以致檔案遭刪除，使用者請自負責任，不得異議。
14. 對準記號的蝕刻深度建議大於 300 nm 。
15. TSRI 標準製程阻劑為 TOK P015 正型阻劑(厚度 400 nm)、Sumitomo NEB 負型阻劑(厚度 400 nm)。
16. 本機台固定 500um 的 write field ,最小曝光 stepping (pixel) 為 10 nm，請勿小於此設定。
17. 會影響真空系統與磁場干擾的材料，如:高揮發性材料、磁性材料與粉體材料等，請勿進入此機台.
18. 不導電材料,需經導電層處理才可曝光。